

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成18年8月3日(2006.8.3)

【公表番号】特表2002-518559(P2002-518559A)

【公表日】平成14年6月25日(2002.6.25)

【出願番号】特願2000-555948(P2000-555948)

【国際特許分類】

C 08 F 2/38 (2006.01)

C 08 F 4/00 (2006.01)

【F I】

C 08 F 2/38

C 08 F 4/00

【手続補正書】

【提出日】平成18年6月12日(2006.6.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

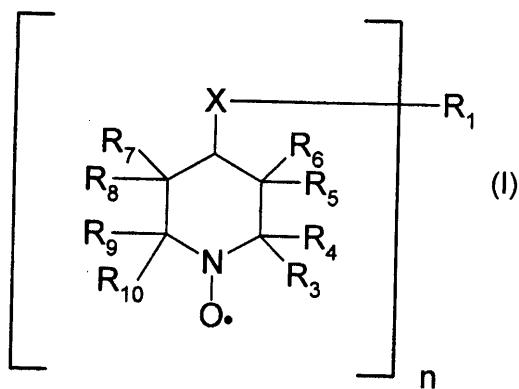
【特許請求の範囲】

【請求項1】 a) 少なくとも一種のエチレン性不飽和モノマーまたはオリゴマーと

b) 該エチレン性不飽和モノマーまたはオリゴマーの重合を開始することが可能なラジカル源と、

c) 少なくとも一種の次式(I)

【化1】



[式中、

nは、1または2を表し、

R3、R4、R9、R10は、互いに各々独立して、炭素原子数1ないし18のアルキル基、炭素原子数2ないし18のアルケニル基または炭素原子数2ないし18のアルキニル基を表すか、または

R3とR4および/またはR9とR10は、結合する炭素原子と一緒にになって、炭素原子数3ないし12のシクロアルキル基を形成し、

R5、R6、R7、R8は、互いに各々独立して、水素原子、炭素原子数1ないし18のアルキル基、炭素原子数2ないし18のアルケニル基または炭素原子数2ないし18のアルキニル基を表し、

X は、 - O - 、 - O - C (O) - 、 - N R₂ - または - N R₂ - C (O) - を表し、 R₂ は、水素原子、炭素原子数 1 ないし 18 のアルキル基またはフェニル基を表し、 n が 1 を表す場合、

R₁ は、炭素原子数 8 ないし 36 のアルキル基、炭素原子数 8 ないし 36 のアルケニル基または炭素原子数 8 ないし 36 のアルキニル基を表し、 n が 2 を表す場合、

R₁ は、炭素原子数 10 ないし 36 のアルキレン基、炭素原子数 10 ないし 36 のアルケニレン基または炭素原子数 10 ないし 36 のアルキニレン基を表す。] で表される化合物を含む重合性組成物。

【請求項 2】 少なくとも一種のエチレン性不飽和モノマーまたはオリゴマーの遊離ラジカル重合による、オリゴマー、コオリゴマー、ポリマーまたはコポリマー（ブロックまたはランダム）の製造方法であって、遊離ラジカル源および請求項 1 記載の式 I で表される化合物の存在下で、モノマーまたはモノマー / オリゴマーを加熱し、そして該エチレン性不飽和モノマーまたはオリゴマーを重合することからなる方法。